

## OBSAH

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>VYSOKOFREKVENČNÍ NAPRAŠOVÁNÍ</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1</b>	<b>Chemické reakce v plazmatu</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2</b>	<b>Význam záporného předpětí</b> .....	<b>8</b>
<b>2.3</b>	<b>Reaktivní naprašování</b> .....	<b>8</b>
2.3.1	Vliv parametrů depozice na kvalitu vrstvy .....	8
2.3.2	Chemisorpce .....	9
<b>2.4</b>	<b>Charakterizační metody</b> .....	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>NAPRAŠOVÁNÍ <math>\text{SiN}_x\text{:H}</math> S LEPTÁNÍM SI POVRCHU V PLAZMATICKÉM <math>\text{H}_2</math></b> .....	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>VRSTVY ALN NAPRAŠOVANÉ VE SMĚSI PLYNŮ AR/<math>\text{N}_2</math>/<math>\text{H}_2</math></b> .....	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>ZÁVĚR</b> .....	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>LITERATURA</b> .....	<b>22</b>